【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和1年8月8日(2019.8.8)

【公開番号】特開2019-8942(P2019-8942A)
【公開日】平成31年1月17日(2019.1.17)
【年通号数】公開・登録公報2019-002
【出願番号】特願2017-122291(P2017-122291)
【国際特許分類】
Ｈ０５Ｂ　33/28　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　51/50　(2006.01)
Ｈ０５Ｂ　33/26　(2006.01)
Ｈ０５Ｂ　33/10　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０５Ｂ　33/28
Ｈ０５Ｂ　33/14　Ａ
Ｈ０５Ｂ　33/26　Ｚ
Ｈ０５Ｂ　33/10

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月20日(2019.6.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
支持基板上に第１電極の材料をドライプロセスにより成膜して前記第１電極を形成する第１形成工程と、
前記第１電極にプラズマ処理を施す処理工程と、
前記処理工程の後に、前記第１電極上に第２電極を形成する第２形成工程と、を含み、
前記第１形成工程では、前記第１電極を金属で形成し、
前記処理工程では、不活性ガスの雰囲気下で前記第１電極にプラズマ処理を施し、
前記第２形成工程では、前記第２電極を塗布法により形成する、透明電極の製造方法。
【請求項２】
前記第１形成工程では、複数の開口部を含む所定パターンを有する前記第１電極を形成し、
前記第２形成工程では、前記第１電極上及び前記開口部から露出する前記支持基板上に前記第２電極を形成する、請求項１に記載の透明電極の製造方法。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の透明電極の製造方法により製造された透明電極上に有機機能層を形成する第３形成工程と、
前記有機機能層上に第３電極を形成する第４形成工程と、を含む、電子デバイスの製造方法。